

【支援装置料金表 <データ提供あり>】2026年4月1日 改定
北海道大学 ナノテクノロジー連携研究推進室

ARIM装置番号	装置名	メーカー	型式	基本料		利用料(1時間あたり)		技術補助料		技術代行料	
				学外者	学外者(大学の機関)	学外者(大学の機関)	学外者(一般)	学外者(大学の機関)	学外者(一般)		
AP-200001	超高精度電子ビーム描画装置 125kV	エリオニクス	ELS-F125-U	35,200	7,500	21,200	11,900	25,600	16,300	30,000	
AP-200002	超高精度電子ビーム描画装置 100 kV	エリオニクス	ELS-7000HM	35,200	5,900	19,300	10,300	23,700	14,700	28,100	
AP-200003	マスクアライナー	ミカサ	MA-20	13,200	1,400	2,100	5,800	6,500	10,200	10,900	
AP-200004	レーザー描画装置	ネオアーク	DDB-201-200	22,000	900	3,000	5,300	7,400	9,700	11,800	
AP-200005	真空蒸着装置	サンバック	ED-1500R	22,000	1,600	2,100	6,000	6,500	10,400	10,900	
AP-200006	プラズマCVD装置	サムコ	PD-220ESN	22,000	3,000	5,800	7,400	10,200	11,800	14,600	
AP-200007	液体ソースプラズマCVD装置	サムコ	PD-10C1	22,000	700	800	5,100	5,200	9,500	9,600	
AP-200008	ヘリコンスパッタリング装置	アルバック	MFS-4000C1/HC1	13,200	4,100	5,400	8,500	9,800	12,900	14,200	
AP-200009	イオンビームスパッタ装置	アルバック	IBS-6000S	13,200	1,600	2,100	6,000	6,500	10,400	10,900	
AP-200010	原子層堆積装置(ALD)	Picosun	SUNALE-R	13,200	3,100	5,200	7,500	9,600	11,900	14,000	
AP-200012	反応性イオンエッチング装置 RIE-1011PH	サムコ	RIE-1011PH	13,200	2,900	5,000	7,300	9,400	11,700	13,800	
AP-200013	反応性イオンエッチング装置 RIE-10NVR	サムコ	RIE-10NVR	13,200	2,900	4,700	7,300	9,100	11,700	13,500	
AP-200014	ドライエッチング装置	アルバック	NLD-500	13,200	1,200	1,800	5,600	6,200	10,000	10,600	
AP-200015	イオンミリング装置	アルバック	HBE-6000S	13,200	1,300	1,700	5,700	6,100	10,100	10,500	
AP-200017	電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6700FT	22,000	1,300	1,300	5,700	5,700	10,100	10,100	
AP-200018	電子ビーム描画装置	エリオニクス	ELS-3700	26,400	1,000	1,800	5,400	6,200	9,800	10,600	
AP-200020	両面マスクアライナ	ズースマイクロテック	MA-6	17,600	1,000	2,900	5,400	7,300	9,800	11,700	
AP-200027	EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	アルバック	EBX-8C	35,200	2,600	2,900	7,000	7,300	11,400	11,700	
AP-200034	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM-6500F	35,200	2,500	4,500	6,900	8,900	11,300	13,300	
AP-200036	超高圧電子顕微鏡群	日本電子	JEM-ARM1300	70,400	3,900	5,300	8,300	9,700	12,700	14,100	
AP-200041	超薄膜評価装置	日立	HD-2000	17,600	2,800	7,300	7,200	11,700	11,600	16,100	
AP-200042	集束イオンビーム加工観察装置	日立	FB-2100	22,000	2,500	4,900	6,900	9,300	11,300	13,700	
AP-200043	透過電子顕微鏡(TEM)	日本電子	JEM2010	35,200	2,400	4,600	6,800	9,000	11,200	13,400	
AP-200045	フォルトドメイン電子プロブマイクロアナライザ(FE-EPMA)	日本電子	JXA-8530F	35,200	3,800	8,600	8,200	13,000	12,600	17,400	
AP-200046	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)	日本電子	JIB-4601F	35,200	3,600	5,800	8,000	10,200	12,400	14,600	
AP-200047	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM/EDS-EBSOオプション)	日本電子	JIB-4601F	0	400	800	400	800	400	800	
AP-200052	オージェ電子分光装置(AES-EBSD)	日本電子	JAMP-9500F	35,200	2,400	7,900	6,800	12,300	11,200	16,700	
AP-200053	X線光電子分光装置(XPS)	日本電子	JPS-9200	35,200	1,900	5,500	6,300	9,900	10,700	14,300	
AP-200056	時間分解光電子顕微鏡システム	エルミテック	PEEM-III	140,800	2,700	5,600	7,100	10,000	11,500	14,400	
AP-200058	エリブゾータ	日本分光社	M-500S	6,200	200	700	4,600	5,100	9,000	9,500	
AP-200059	超高速スキャン高精度電子ビーム露光装置 130kV	エリオニクス	ELS-F130HM	35,200	9,600	29,300	14,000	33,700	18,400	38,100	
AP-200060	半導体薄膜堆積装置(PLD)	パスカル	PAC-LMBE	35,200	2,700	6,100	7,100	10,500	11,500	14,900	
AP-200061	高分解能3次元構造評価装置	日本FEI	Titan3 G2 60-300	70,400	7,600	30,000	12,000	34,400	16,400	38,800	
AP-200062	取差修正走査型透過電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM200F	44,000	5,600	16,400	10,000	20,800	14,400	25,200	
AP-200066	コンバクトスパッタ装置	アルバック	ACS-4000-C3-HS	13,200	3,700	5,500	8,100	9,900	12,500	14,300	
AP-200067	ICP高密度プラズマエッチング装置	サムコ	RIE-101HS	13,200	2,700	6,500	7,100	10,900	11,500	15,300	
AP-200068	スパッタ装置	菅製作所	SSP3000Plus	26,400	700	1,600	5,100	6,000	9,500	10,400	
AP-200069	ダイシングソー	DISCO	DAD322	17,600	700	1,000	5,100	5,400	9,500	9,800	
AP-200070	大気中光電子分光装置	理研計器	AC-3	13,200	2,200	4,200	6,600	8,600	11,000	13,000	
AP-200071	超高分解能走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	SU8230	26,400	2,500	4,700	6,900	9,100	11,300	13,500	
AP-200072	多元スパッタ装置	アルバック	QAM-4-ST	26,400	5,800	7,300	10,200	11,700	14,600	16,100	
AP-200073	シリコ深堀りエッチング装置	SPPTek/ロジーズ	SPX-ASE-Pegasus-Polaris	35,200	4,900	10,100	9,300	14,500	13,800	18,900	
AP-200074	電子ビーム蒸着装置	エイコーエンジニアリング	EB-580S	26,400	2,400	3,200	6,800	7,600	11,200	12,000	
AP-200075	レーザー顕微鏡	キーエンス	VK-9700/9710	26,400	700	1,400	5,100	5,800	9,500	10,200	
AP-200076	UV-オゾンクリーナー	サムコ	UV-1	8,800	600	600	5,000	5,000	9,400	9,400	
AP-200077	光学干渉式膜厚計	フィルメトリス	F20-UV	26,400	700	900	5,100	5,300	9,500	9,700	
AP-200078	原子層堆積装置(粉末対応型)	ピコサン	R-200 advanced	26,400	4,900	8,200	9,300	12,600	13,700	17,000	
AP-200079	精密イオンミリングシステム	Gatan	PIPSH model 695	35,200	1,300	1,400	5,700	5,800	10,100	10,200	
AP-200080	レーザー描画装置	ハイデルベルグ・ドイツ・システム	DWL66HK	35,200	5,100	8,700	9,500	13,100	13,900	17,500	
AP-200081	集束イオンビーム加工観察装置	日本電子	JEM-9320FIB	0	2,200	4,900	6,600	9,300	11,000	13,700	
AP-200082	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9200	30,800	1,800	5,500	6,200	9,900	10,600	14,300	
AP-200083	プラズマ式原子層堆積装置	サムコ	AD-230LP-H	35,200	6,300	12,200	10,700	16,600	15,100	21,000	
AP-200084	卓上型ランプ加熱装置	アドバンス理工	MLA-5000-P-N	35,200	1,800	1,900	6,200	6,300	10,600	10,700	
AP-200085	量子・電子制御ナノメトリック顕微鏡測定装置	日本電子	JEM-ARM200F NEDARM	35,200	4,800	11,700	9,200	16,100	13,600	20,500	
AP-200086	ガラスインプリント装置	芝浦機械	GMP-415V	35,200	2,200	4,800	6,600	9,200	11,000	13,600	
AP-200087	顕微紫外可視分光装置	日本分光	MSV-5200	8,800	2,100	3,200	6,500	7,600	10,900	12,000	
AP-200088	微細形状測定機	小坂研究所	ET200	17,600	600	800	5,000	5,200	9,400	9,600	
AP-200089	マニュアルスパッタ	(自作)		0	17,600	700	1,200	5,100	5,600	9,500	10,000
AP-200090	ラマンイメージング装置	堀場製作所	HR-Evolution type pa nano	26,400	2,900	4,200	7,300	8,600	11,700	13,000	
AP-200091	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM7200F	8,800	2,700	4,300	7,100	8,700	11,500	13,100	
AP-200092	触針式アブフライヤー(段差計)	KLA-Tencor	Alpha-Step D-500	26,400	400	700	4,800	5,100	9,200	9,500	
AP-200093	紫外可視近赤外分光光度計(積分球付き)	島津製作所	UV-8000 Plus / MPC-603A	26,400	800	1,300	5,200	5,700	9,600	10,100	
AP-200094	分光蛍光光度計	日立ハイテック	F-7100	26,400	800	1,300	5,200	5,700	9,600	10,100	
AP-200095	フッ化ケセンドライエッチング装置	サムコ	VPE-4F	8,800	1,900	2,700	6,300	7,100	10,700	11,500	
AP-200096	電子線レーザー描画露光機シミュレータ(ソフトウェア)	GeniSys	BEAMER Pro	8,800	1,300	2,600	5,700	7,000	10,100	11,400	
AP-200097	FIB-SEM複合装置	日立ハイテック	Ethos NX5000	44,000	6,900	15,800	11,300	20,200	15,700	24,600	
AP-200098	全自動真空蒸着装置	エイブイシー	ADS-E86L	26,400	7,300	11,600	11,700	16,000	16,100	20,400	

技術支援料(サンプル前処理・設計等)	技術相談料
4,400円 / 時間	11,000円 / 時間
(ただし、高度な知識及び経験が必要とされる作業、複数の技術を組み合わせる作業、その他の難易度の高い作業を行う場合において128,800円)	

【支援装置料金表 <データ提供なし>】2026年4月1日 改定
北海道大学 ナノテクノロジー連携研究推進室

ARIM装置番号	装置名	メーカー	型式	基本料		利用料(1時間あたり)		技術補助料		技術代行料	
				学外者	学外者(大学・公的機関)	学外者(大学・公的機関)	学外者(一般)	学外者(大学・公的機関)	学外者(一般)		
AP-200001	超高精度電子ビーム描画装置 125kV	エリオニクス	ELS-F125-U	35,200	9,600	27,300	14,000	31,700	18,400	36,100	
AP-200002	超高精度電子ビーム描画装置 100 kV	エリオニクス	ELS-7000HM	35,200	7,600	24,800	12,000	29,200	16,400	33,600	
AP-200003	マスクアライナー	ミカサ	MA-20	13,200	1,800	2,600	6,200	7,000	10,600	11,400	
AP-200004	レーザー描画装置	ネオアーク	DDB-201-200	22,000	1,100	3,800	5,500	8,200	9,900	12,600	
AP-200005	真空蒸着装置	サンバック	ED-1500R	22,000	2,000	2,700	6,400	7,100	10,800	11,500	
AP-200006	プラズマCVD装置	サムコ	PD-220ESN	22,000	3,900	7,400	8,300	11,800	12,700	16,200	
AP-200007	液体ソースプラズマCVD装置	サムコ	PD-10C1	22,000	900	1,100	5,300	5,500	9,700	9,900	
AP-200008	ヘリコンスパッタリング装置	アルバック	MFS-4000C1/HC1	13,200	5,300	6,900	9,700	11,300	14,100	15,700	
AP-200009	イオンビームスパッタ装置	アルバック	IBS-6000S	13,200	2,100	2,700	6,500	7,100	10,900	11,500	
AP-200010	原子層堆積装置(ALD)	Picosun	SUNALE-R	13,200	3,900	6,700	8,300	11,100	12,700	15,500	
AP-200012	反応性イオンエッチング装置 RIE-1011PH	サムコ	RIE-1011PH	13,200	3,800	6,400	8,200	10,800	12,600	15,200	
AP-200013	反応性イオンエッチング装置 RIE-10NVR	サムコ	RIE-10NVR	13,200	3,700	6,000	8,100	10,400	12,500	14,800	
AP-200014	ドライエッチング装置	アルバック	NLD-500	13,200	1,500	2,300	5,900	6,700	10,300	11,100	
AP-200015	イオンミリング装置	アルバック	IBE-6000S	13,200	1,700	2,100	6,100	6,500	10,500	10,900	
AP-200017	電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6700FT	22,000	1,600	1,700	6,000	6,100	10,400	10,500	
AP-200018	電子ビーム描画装置	エリオニクス	ELS-3700	26,400	1,300	2,300	5,700	6,700	10,100	11,100	
AP-200020	両面マスクアライナ	ズースマイクロテック	MA-6	17,600	1,200	3,800	5,600	8,200	10,000	12,600	
AP-200027	EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	アルバック	EBX-8C	35,200	3,300	3,700	7,700	8,100	12,100	12,500	
AP-200034	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM-6500F	35,200	3,200	5,800	7,600	10,200	12,000	14,600	
AP-200036	超高圧電子顕微鏡群	日本電子	JEM-ARM1300	70,400	5,100	6,800	9,500	11,200	13,900	15,600	
AP-200041	超薄膜評価装置	日立	HD-2000	17,600	3,600	9,300	8,000	13,700	12,400	18,100	
AP-200042	集束イオンビーム加工観察装置	日立	FB-2100	22,000	3,200	6,200	7,600	10,600	12,000	15,000	
AP-200043	透過電子顕微鏡(TEM)	日本電子	JEM2010	35,200	3,100	5,900	7,500	10,300	11,900	14,700	
AP-200045	フォトルミネッセンス電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)	日本電子	JXA-8530F	35,200	4,800	11,100	9,200	15,500	13,600	19,900	
AP-200046	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)	日本電子	JIB-4601F	35,200	4,600	7,400	9,000	11,800	13,400	16,200	
AP-200047	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)EDSオプション	日本電子	JIB-4601F	0	500	1,000	500	1,000	500	1,000	
AP-200052	オージェ電子分光装置(AES-EBS)	日本電子	JAMP-9500F	35,200	3,100	10,100	7,500	14,500	11,900	18,900	
AP-200053	X線光電子分光装置(XPS)	日本電子	JPS-9200	35,200	2,400	7,000	6,800	11,400	11,200	15,800	
AP-200056	時間分解光電子顕微鏡システム	エルミテック	PEEM-III	140,800	3,500	7,200	7,900	11,600	12,300	16,000	
AP-200058	エリブゾータ	日本分光社	M-500S	6,200	200	900	4,600	5,300	9,000	9,700	
AP-200059	超高速スキャン高精度電子ビーム露光装置 130kV	エリオニクス	ELS-F130HM	35,200	12,300	37,700	16,700	42,100	21,100	46,500	
AP-200060	半導体薄膜堆積装置(PLD)	パスカル	PAC-LMBE	35,200	3,500	7,800	7,900	12,200	12,300	16,600	
AP-200061	高分解能3次元構造評価装置	日本FEI	Titan3 G2 60-300	70,400	9,800	38,500	14,200	42,900	18,600	47,300	
AP-200062	取差修正走査型透過電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM200F	44,000	7,200	21,100	11,600	25,500	16,000	29,900	
AP-200066	コンパクトスパッタ装置	アルバック	ACS-4000-C3-HS	13,200	4,800	7,100	9,200	11,500	13,600	15,900	
AP-200067	ICP高密度プラズマエッチング装置	サムコ	RIE-101HS	13,200	3,500	8,400	7,900	12,800	12,300	17,200	
AP-200068	スパッタ装置	蓄製作所	SSP3000Plus	26,400	900	2,000	5,300	6,400	9,700	10,800	
AP-200069	ダイシングソー	DISCO	DAD322	17,600	900	1,300	5,300	5,700	9,700	10,100	
AP-200070	大気中光電子分光装置	理研計器	AC-3	13,200	2,900	5,400	7,300	9,800	11,700	14,200	
AP-200071	超高分解能走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	SU8230	26,400	3,200	6,000	7,600	10,400	12,000	14,800	
AP-200072	多元スパッタ装置	アルバック	QAM-4-ST	26,400	7,500	9,400	11,900	13,800	16,300	18,200	
AP-200073	シリコ深堀りエッチング装置	SPPTek/ロジーズ	SPX-ASE-Pegasus-Pulsar	35,200	6,300	12,900	10,700	17,300	15,100	21,700	
AP-200074	電子ビーム蒸着装置	エイコーエンジニアリング	EB-580S	26,400	3,100	4,100	7,500	8,500	11,900	12,900	
AP-200075	レーザー顕微鏡	キーエンス	VK-9700/9710	26,400	900	1,800	5,300	6,200	9,700	10,600	
AP-200076	UV-オゾンクリーナー	サムコ	UV-1	8,800	800	800	5,200	5,200	9,600	9,600	
AP-200077	光学干渉式膜厚計	フィルメトリクス	F20-UV	26,400	800	1,100	5,200	5,500	9,600	9,900	
AP-200078	原子層堆積装置(粉末対応型)	ピコサン	R-200 advanced	26,400	6,200	10,600	10,600	15,000	15,000	19,400	
AP-200079	精密イオンミリングシステム	Gatan	PIPSH model 695	35,200	1,700	1,800	6,100	6,200	10,500	10,600	
AP-200080	レーザー描画装置	ハダセルデザインシステム	DWL66HK	35,200	6,600	11,100	11,000	15,500	15,400	19,900	
AP-200081	集束イオンビーム加工観察装置	日本電子	JEM-9320FIB	0	2,800	6,300	7,200	10,700	11,600	15,100	
AP-200082	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9200	30,800	2,300	7,100	6,700	11,500	11,100	15,900	
AP-200083	プラズマ式原子層堆積装置	サムコ	AD-230LP-H	35,200	8,100	15,700	12,500	20,100	16,900	24,500	
AP-200084	卓上型ランプ加熱装置	アドバン理工	MLA-5000-P-N	35,200	2,300	2,400	6,700	6,800	11,100	11,200	
AP-200085	量子・電子制御ナノメトリクス顕微鏡測定装置	日本電子	JEM-ARM200F NEDARM	35,200	6,100	15,000	10,500	19,400	14,900	23,800	
AP-200086	ガラスインプリント装置	芝浦機械	GMP-415V	35,200	2,800	6,100	7,200	10,500	11,600	14,900	
AP-200087	顕微紫外可視分光装置	日本分光	MSV-5200	8,800	2,700	4,100	7,100	8,500	11,500	12,900	
AP-200088	微細形状測定機	小坂研究所	E7200	17,600	800	1,100	5,200	5,500	9,600	9,900	
AP-200089	マニュアルスパッタ	(自作)		0	17,600	900	1,500	5,300	5,900	9,700	10,300
AP-200090	ラマンイメージング装置	堀場製作所	HR-Evolution type pa nano	26,400	3,800	5,400	8,200	9,800	12,600	14,200	
AP-200091	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM7200F	8,800	3,500	5,500	7,900	9,900	12,300	14,300	
AP-200092	触針式アトモグラフィ(段差計)	KLA-Tencor	Alpha-Step D-500	26,400	500	900	4,900	5,300	9,300	9,700	
AP-200093	紫外可視近赤外分光光度計(積分球付き)	島津製作所	UV-8000 Plus / MPC-603A	26,400	1,000	1,600	5,400	6,000	9,800	10,400	
AP-200094	分光蛍光光度計	日立ハイテック	F-7100	26,400	1,000	1,700	5,400	6,100	9,800	10,500	
AP-200095	フッ化ケセンドライエッチング装置	サムコ	VPE-4F	8,800	2,500	3,500	6,900	7,900	11,300	12,300	
AP-200096	電子線レーザー描画露光機シミュレータ(ソフトウェア)	GeniSys	BEAMER Pro	8,800	1,700	3,300	6,100	7,700	10,500	12,100	
AP-200097	FIB-SEM複合装置	日立ハイテック	Ethos NX5000	44,000	8,800	20,400	13,200	24,800	17,600	29,200	
AP-200098	全自動真空蒸着装置	エイブイシー	ADS-E86L	26,400	9,300	14,900	13,700	19,300	18,100	23,700	

技術支援料(サンプル前処理・設計等)	技術相談料
4,400円 / 時間	11,000円 / 時間
(ただし、高度な知識及び経験が必要とされる作業、複数の技術を組み合わせる作業、その他の難易度の高い作業を行う場合において128,800円)	